

Vedlegg 2 - GAP analyse – behandling av CU impregnert materiale i samforbrenning med RT flis - måleprogram

Vedlegg 2

Eidsiva Bioenergi AS søker Fylkesmannen i Hedmark om å endre konsesjon til Eidsiva Bioenergi AS RT-flisanlegg i Elverum, slik at CU-impregnert materiale kan sambrennes med returflis (RT flis). Det søkes med den bakgrunn om at ny utslippstillatelse innrettes i.h.t. avfallsforskriften kap.10. forbrenning av avfall.

GAP analyse Måleprogram – utslipp RT kjel i Elverum Fjernvarmeanlegg i forbindelse med søknad om endret konsesjon i.h.t. Avfallsforskrift kap. 10.

Tabell sammenstilles for å se om det er GAP mellom krav og målinger.

Grønt fyll betyr at krav er ivaretatt

Rødt ikke krav ikke ivaretatt, må inngå i måleprogram ved endring av konsesjon

Krav – Utslppsparameter	Krav	Enhet	Måleprogram online EFV	Måleprogram 3. part	Merknad
Døgnmiddelverdier					
Totalt støv	10	mg/Nm ³			
CO	10	mg/Nm ³			Ikke krav
Gass- og dampformige organiske forbindelser, uttrykt som totalt organisk karbon (TOC)	10	mg/Nm ³			Søke om fritak fra kontinuerlig måling.
Hydrogenklorid (HCl)	10	mg/Nm ³			
Hydrogenfluorid (HF)	1	mg/Nm ³			Søke om fritak fra kontinuerlig måling.
Svoveldioksid (SO ₂)	50	mg/Nm ³			
Nitrogenmonoksid (NO) og nitrogendioksid (NO ₂), uttrykt som nitrogendioksid	200	mg/Nm ³			
30 min verdier - 100%					
Totalt støv	30	mg/Nm ³			
CO	10	mg/Nm ³			

Vedlegg 2 - GAP analyse – behandling av CU impregnert materiale i samforbrenning med RT flis - måleprogram

Gass- og dampformige organiske forbindelser, uttrykt som totalt organisk karbon (TOC)	20	mg/Nm ³			
Hydrogenklorid (HCl)	60	mg/Nm ³			
Hydrogenfluorid (HF)	4	mg/Nm ³			
Svoveldioksid (SO ₂)	200	mg/Nm ³			
Nitrogenmonoksid (NO) og nitrogendioksid (NO ₂), uttrykt som nitrogendioksid	400	mg/Nm ³			
3. parts målinger 2 g. år					
Totalt støv					
CO					
Gass- og dampformige organiske forbindelser, uttrykt som totalt organisk karbon (TOC)					
Hydrogenklorid (HCl)					
Hydrogenfluorid (HF)					
Svoveldioksid (SO ₂)					
Nitrogenmonoksid (NO) og nitrogendioksid (NO ₂), uttrykt som nitrogendioksid					
Thallium og thalliumforbindelser, uttrykt som thallium (Tl)	totalt 0,05				mg/Nm ³
Kvikksølv og kvikksølvforbindelser, uttrykt som kvikksølv (Hg)	0,03				mg/Nm ³
Vanadium og vanadiumforbindelser, uttrykt	totalt 0,5				mg/Nm ³

Vedlegg 2 - GAP analyse – behandling av CU impregnert materiale i samforbrenning med RT flis - måleprogram

som vanadium (V)					
Antimon og antimonforbindelser, uttrykt som antimon (Sb)					
Arsen og arsenforbindelser, uttrykt som arsen (As)					
Bly og blyforbindelser, uttrykt som bly (Pb)					
Krom og kromforbindelser, uttrykt som krom (Cr)					
Kobolt og koboltforbindelser, uttrykt som kobolt (Co)					
Kobber og kobberforbindelser, uttrykt som kobber (Cu)					
Mangan og manganforbindelser, uttrykt som mangan (Mn)					
Kadmium og kadmiumforbindelser, uttrykt som kadmium (Cd)					
Nikkel og nikkelforbindelser, uttrykt som nikkel (Ni)					
CO					
Dioksiner, definert i henhold til vedlegg I til dette kapitlet	0,1				ng/Nm ³